



第2回 酸化物半導体討論会

学際・国際的高度人材育成ライフイノベーション材料創製共同研究プロジェクト 分科会
第76回 フロンティア材料研究所講演会

2018年10月26日 (金)
R3棟1F会議室

13:00~13:05 「はじめに」

13:05~13:35 「アモルファス酸化物半導体の欠陥と欠陥制御に基づく新規応用の開拓」
井手 啓介先生 東京工業大学 助教

13:35~14:05 「原子層堆積 Al_2O_3 膜の酸化物半導体ゲート絶縁膜への応用」
平岩 篤先生 早稲田大学 教授

14:05~14:35 「プラズマアシスト反応性プロセスを用いた低温での高移動度薄膜トランジスタの作製」
竹中 弘祐先生 大阪大学 助教

14:50~15:20 「高性能酸化物薄膜トランジスタとその新展開」
浦岡 行治先生 奈良先端科学技術大学院大学 教授

15:20~15:50 「スパッタ法を用いた酸化物半導体薄膜の作製およびTFT特性」
Junjun Jia先生 青山学院大学 助教

16:05~16:35 「ヘテロチャネルIGZO TFTの特性・信頼性」
古田 守先生 高知工科大学 教授

16:35~17:05 「酸化物半導体デバイスのニューロモーフイック応用」
木村 睦先生 龍谷大学 教授

17:05~17:10 「終わりに」

<http://www.msl.titech.ac.jp/~tkamiya/touron>
から参加登録をお願い致します。締切10/19

東京工業大学すすかけ台キャンパス 横浜市緑区長津田町4259

